

2026 年 9 月 15 日

株式会社ニューフレアテクノロジー

フォトマスク関連技術の国際会議「SPIE Photomask Technology + Extreme Ultraviolet Lithography」に参加

ニューフレアテクノロジー（NFT）は、2026 年 9 月 8 日から 11 日まで米国カリフォルニア州モンレー市で開催された「SPIE Photomask Technology + Extreme Ultraviolet Lithography」に参加しました。

本会議は、光学やフォトニクス分野における国際学会である SPIE（The International Society for Optical Engineering、国際光工学会）が毎年開催しているもので、フォトマスクとパターンング、計測器、測定、材料、検査、修理、マスクビジネス、High-NA EUV リソグラフィーなどに関する国際的な学術会議です。

NFT は、本会議に毎年参加しており、今年もマルチ電子ビームマスク描画装置に関する最新の開発状況について 1 件の口頭発表、1 件のポスター発表を行いました。

<SPIE Photomask Technology + Extreme Ultraviolet Lithography での NFT の口頭発表／ポスター発表>

Session

Paper 14273-5

[MBM-4000: latest results and additional benefits enabled by edge dose enhancement](#)

Author(s): Kenichi Yasui, Jumpei Yasuda, Hiroshi Matsumoto, Daisuke Hara, Shinichi Sasaki, Hayato Kimura, Yoshinori Kojima, NuFlare Technology, Inc. (Japan)

Presenter: Kenichi Yasui, NuFlare Technology, Inc. (Japan)

Poster Session

Paper 14273-50

[Electron multi-beam mask writer evaluation using sine wave patterns: consolidated findings and practical insights](#)

Author(s): Makoto Kawano, Shinichi Sasaki, Hikari Ogawa, Aki Mukai, Tianyue Zhou, Takuma Abe, Yoshiyuki Negishi, Hideki Matsui, Yoshinori Kojima, NuFlare Technology, Inc. (Japan)

Presenter: Makoto Kawano, NuFlare Technology, Inc. (Japan)

関連リンク：

[SPIE Photomask Technology + Extreme Ultraviolet Lithography](#)

以上